PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-039480

(43) Date of publication of application: 19.02.1993

(51)Int.CI.

C09K 9/02 C09K 3/00

G03C 1/685

(21)Application number: 03-218089

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22) Date of filing:

05.08.1991

(72)Inventor: YOSHIDA TAKUJI

OZAWAGUCHI HARUKI

(54) PHOTOREFRACTIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the subject composition, comparable in absolute refractive index to quartz, thus eliminating the connection loss with quartz-based optical fiber, also with no need for electric field application, consisting of a copolymer of a photorefractive material and a specific resin.

CONSTITUTION: The objective composition capable of reversibly changing its refractive index by light, consisting of a copolymer of (A) a photorefractive material with its refractive index changeable by light irradiation and (B) a fluorine-contg. resin capable of regulating the refractive index. The present composition can freely control its absolute refractive index and its adhesiveness to quartz, therefore being favorable in use. The use of a photochromic compound such as spiro(2H-1-benzopyran-2,2-indoline) as the component A gives the present composition of self-supportive type with little energy consumption.

1

Element 12 Element 12 公開特許公報。

F :

11. 特許出願公開番号

特開平5-39480

48 公開日 平成8年 11993 2月19日

識別記号 宁内整理番号

技術表示箇所

009K 9190

B 8981-4H

3 00

U 9043-4H

9030 : 885

89:1-0H

審査請求 未請求 請求項の数3 (全13頁

21) 王願番号

特額平3-218089

717 出願人 000004226

日本電信電話株式会社

(22) 出願日 平成3年(1991) 8月5日

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

172 発明者 吉田 卓史

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 小澤口 治樹

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外2名)

(54)【発明の名称】フオトリフラクテイブ組成物

(57)【要約】

【目的】 絶対屈折率を石英系と同し程度にして接続損 失をなくし、更に相分離をなくし透明な任意の濃度の重 合体を作製でき、電界を印加しないフォトリフラクティ ブ材料を提供する。

【構成】 光照射によって屈折率が変化するフォトリフ ラクティブ材料と、屈折率を調整するフッ素含有樹脂と からなるフォトリフラクティブ組成物。両者は共重合体 であってもよい。フォトリフラクティブ材料の例には、 フォトクロミック化合物がある。

【効果】 フォトクコミック化合物を用いれば、エネル ギーを消費することがなくなる。また屈折率の変化幅も 大きく、無機のフォトリフラクティブ材料の数百倍に達 する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光によって屈折率を可逆的に変化させる アオトリプラグディブ組成物において、上記組成物が光 照射によって屈折率が変化するフォト (フラグティン材) 料上、風折率を調整するアン素含有樹脂とからなること を特徴とするフォトリアラクティア組成物。

【請求項3】:請求項1に記載の租成物において、フォ トリアラクティフ材料とアル素含有樹脂とか井重合体で あることを特徴とするフォトリアラクディア組成物。

【請求項3】 請求項1只は0に記載の組成物におい で、フォトリフラクティア材料がフォトクロミック化台。 物であることを特徴とするフォトリフラクティア組成 ر رسې

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、元によって屈折率を可 逆的に変化させるフォトリフラクティブ材料に関する。 [0002]

【従来の技術】フォトリフラクティブとは、ここ数年来 注目を集めている現象であって、ある物質に光をあるパー20 絶対屈折率の低いフッ素含有機脂とから構成されること ターンで照射すると光照射した部分の屈折率変化が起こ り、特に、ストロンチウム バリウム サイオブレート (Sr. Ba), Nb, O,) やりチウム ナイオブレ ート(LINDO))に代表される無機物では電界を印 加した場合に屈折率が大きく変化し、変化した屈折率が 安定に保持され、更に別のパターンで光照射を行うと、 最初のパターンが消去されて新たな屈折率分布を持った パターンが形成される、いわゆる可逆的な風折率変化を 示す現象のことである。また、有機物でも同様な効果が、 報告されており、有機物の場合はその屈折率変化が無機 30 物に比較して、数倍~数十倍も大きいことが特徴となっ ている。近年、この可逆的な変化に注目しフォトリフラ ガチャブ材料を用いた光スイッチ、ガ素子の提案(特願) 午3-92662号/か活発に行われている。しかしな から、有機物のフォトリプラグディブ材料を用いるに は、上記の無機物が単結晶として用いられているのに対 して、有機物の単結晶を作製することは事実上非常な因 難を伴うため、透明な媒体に分散させて使用する方法が、 取られていた。そこで大きな屈折率変化を起こさせるに は、透明媒体に分散させるフォットフラクティア有機材、40、有樹脂に分散させる構成ではフォイックラクディア有機 料の濃度を高めなければならないが、ある濃度以上に分 散させると分散媒体との相分離を起こし不透明なものと だってしまう欠点があった。また、出記のように分散で きる濃度に限度があるため 絶針屈折率の制御が分散数 体上分散させるフォトドッラクティブ有機材料の種類に よって決ってしまり、このため従来の石英系ファイバや。 石英系導液路との接続を考慮した場合には、石英の絶対。 囲折違がた。=1. 488であるのに対し 通常の際化 水素系有機物はm。=1.も前後と高いため接続損失が. 大きくなり、また、場合によっては接続が不可能となる。50 になる。また、フォトリンテナティブ有機材料とフッ素

欠点を有していた。更に、従来のフォトリフラウティブ 有機材料は無機物と同じように電界を印加しなければ土 きな屈折率変化は生しなかったため、エネルキーの消費 が著しかった。

(000031

【発明が解決しようとすう課題】本発明の目的は、絶対 **温折率を石英系と同じ程度にして接続損失をなべし、更** に相分離をなべら透明な任意の濃度の重合体を作製で き、電界を印加しないフォトリフラクティブ材料を提供 10 することにある。

(0004)

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明はフォトリアラクティブ組成物に関する発明であっ て、光によって屈折率を可逆的に変化させるフォトリア ラクティブ組成物において、上記組成物が光照射によっ て屈折率が変化するフォトリフラクティブ材料と、屈折 率を調整するフト素含有樹脂とからなることを特徴とす

【0005】本発明はフォトリアラクティブ有機材料と が最も主要な特徴である。また。フォトバフラクティブ 有機材料とフッ素含有樹脂部とが共重合体であってもよ 1、国1に示すように、フォトリフラクティフ有機材料 ↑PC:ヒフッ素含有樹脂(A)、更に通常の樹脂 (B) がっなる共重合体であってもよい。また、こので オトリフラグティフ有機材料がフォトクロミック化合物 であってもよい。すなわち図1は、本発明のフォトリア ラクティブ共重合体の組成を説明する図であり、Aはフ →素含有樹脂、Bは通常の樹脂、PCはフォトリフラク ディブ有機材料を示している。これらの構成比率はAは 11-x-y)、Bは 00≤y≤0 2)、PCは (0, 01≦x≦0, 3) である。

【0006】本発明は、絶対屈折率が石英よりも低いフ ·素含有樹脂と、フォトリフラクティブ有機材料とから 構成されることにより、絶対屈折率が石英の絶対屈折率。 と近い値を取ることができるようになり、石英系ファイ 川や石英千導波路との接続が極めて容易になる利点を有 している。

【りりり7】フォトリフラクティブ有機材料をファ素含 材料とファ素含有樹脂の種類によっては、均一に混合て きず相分離を起こして不透明となることがあるため、構 成比率がある限界値を持つ場合がある。フォトリアラク ディブ有機材料とロッ素含有樹脂とが共重台体であるも のでは、フェトリアラクティブ有機材料の構成比率を自 田に設定することができ、構成比率を高濃度に設定する ことも可能となる。したがって構成比率を変化させるこ とで、高いフォトープラグディブ効果を期待できるよう になり、絶対屈折率も自由に設定することができるよう

特開平日一39480

台有樹脂のほかに更に通常の樹脂を共量台させることも でき、フォトリアラクティブ組成物の絶対屈折率や石英 との密着性などを自由に制御できる。

【60008】更に、フォトリフラクティブ有機材料としてフォトカロミック化合物を用いれば電場を印加することなく元の照射だけで屈折率が変化し、屈折率が変化した後もなんらエネルギーを消費することなく、変化した状態での屈折率を保持できる、いわゆる自己保持型のフォトリフラクティブ組成物が得られる利点を有する。ま

たフェトリコミマ山現象に伴う団折率の変化幅も大きく、無機のフェトリフラクティブ材料と比較すると数百倍に達するなど優れた特徴がある。ここで用いることのできるフォトクコミック化合物は、下記表:~表さに示すスピコピラン類やスピコオキサジン類、フレギド類、ジチエニルエテン類、ジインドリルエテン類である。 【00000】

【表1】

1

化合物名 基本構造式

スピロ(2H-1-ベンゾ
ビラン-2, 2'-インド
リン)
R4
R5
R5

表

[0010]

【表 2】

化 合 物 名	基本構造式
10 10 10 15	多条排足 丸
スピロインドリノナフトピラン	R_4 R_2 R_3 R_1
	R_4 R_2 R_2 R_3
	R_4 R_2 R_3
سر در دار دار در در مرد در در سر دار دار	
スピロベンゾインドリノベンゾピラン	R ₂ R ₃ R ₄
	$ \begin{array}{c} R_2 \\ R_3 \\ R_1 \end{array} $

[0011]

43 【表3】

化 合 物 名	基本構造式
スピコインドリノフェナントロピラン	R_4 R_2 R_3 R_4
	R_4 R_2 R_3 R_1
スピロインドリノアントラピラン	R_4 R_2 R_3 R_1
スピロ〔2 H - 1 - ベンゾ ピラン- 2. 2′ - ベンゾ チアゾリン〕	R_4 \downarrow R_5 R_5
スピロ〔2 H - 1 - ベンゾ ピラン- 2, 2′ - ベンゾ オキサゾリン〕	R 4

化 合 物 名	基本構造式
スピロ (ベンゾチアゾリン -2,3′-〔3H〕-ナフ ト〔2,1-b〕ピラン〕	R, R,
スピロ〔2 H - 1 - ベンゾ ピラン- 2、 2′ - ナフト 〔2、 3 - d〕オキサゾリ ン〕	R_4 N 0 R_5
スピロ〔2 H - 1 - ベンゾ ピラン- 2, 2′ - ナフト 〔2, 1 - d〕オキサゾリ ン〕	R_{Λ} $\downarrow 0$ $\downarrow R_{1}$ $\downarrow R_{5}$
スピロ〔インドリン- 2. 2′-ピラノ〔3, 2-H〕 キノリン〕	R_4 R_2 R_3 R_5 R_1

[0013]

【表 5】

化 合 物 名	基本構造式
スピロ (インゾリン- 2, 3 ' - (3 H) -ナフト (2, 1-b) -1, 4- オモサジン)	R_2 R_3
スピロ (インドリン- 2, 2′- (2 H) -ピラノ (3,4-b) ピリジン)	R_4 R_5 R_5
スピロ (インドリンー 2 , 2 ' - (2 H) - ピラノ (3, 2 - b) ピリジン)	R_{1} R_{2} R_{3} R_{5}
スピロ (インドリンー 2 . 2' - (2 H) - ピラノ [3.2-c] キノリン]	$\begin{array}{c} R_2 \\ R_3 \\ R_1 \end{array}$

[0514]

【表音】

14

表 6

化 合 物 名	基本構造式
スピロ〔2H-1, 4-ベ ンゾキサジン-2, 2'- インドリン〕	$\begin{array}{c} R_2 \\ R_3 \\ R_1 \end{array}$
スピロ〔2 H-1-ベンゾ ピラン-2, 2'-〔2 H〕 キノリン〕	R ₄ R ₅
スピロ [3 Hーナフト (2, 1-b) ピランー3, 2' - [2 H] キノリン]	R_4 N 0 R_1
スピロ〔2 H - 1 - ベンゾ ピラン-2. 2′ - 〔2 H〕 ピリジン〕	R_{5}
スピロ〔3 H - ナフト〔2, 1 - b〕ピラン-3, 2′ - 〔2 H〕ピリジン〕	R ₅

【0015】表中R、~R、はアルキル基を表し、 R.、R. は水素、アルキル基、二トロ基、水酸基、シ 40 作製した。これらの試料をシリコン基板上にスピンコー アノ基、メトキシ基 カルホキシル基、フェニル基又は ハロゲンを表す。

[0016]

【実施例】以下、本発明を実施例で詳細に説明するが、 本発明はこれら実施例に限定されない。

【0017】 実施例1

表7に示す11種類のフッ素含有樹脂と表8~表10に 示すフォトクロミック化合物をフォトクロミック化合物。 が5~30wt%の範囲内になるようにそれぞれ配合し、 メチルイソブチルケトン (MIBK) とクロロベンゼン 50 【表7】

の1:1溶媒に溶解させフォトリフラクティブ組成物を ト法で薄膜化した。屈折率を測定したところ、絶対屈折 率は $n_0=1$. $4\sim1$. 5の範囲で石英に非常に近い値 であることが分かった。この薄膜化した試料に、500 Wの超高圧水銀灯に色ガラスフィルターを装着した光源 から紫外線 [365 nm] を照射して、フォトクロミズ ム変化を起こさせた。紫外線を照射する前後の屈折率を 測定し、屈折率変化を追跡したところ、すべての試料で 屈折率の変化が起こっていることが分かった。

[0018]

	X	CH₃	
No.	R	T g (°C)	nв
1	CH ₂ CF ₃	82	1.415
2	CH ₂ C ₂ F ₅	77	1. 392
3	CH ₂ C ₂ F ₄ H	68	1. 422
4	CH ₂ C ₄ F ₈ H	47	1.392
5	CH2CH2CaF17	Tm 87	1. 373
	X	F	
	R	Т g (℃)	n p
6	CH ₃	142	1.457
7	CH ₂ CF ₃	125	1.386
8	CH ₂ C ₂ F ₅	101	1.368
6	CH 2 C 2 F 4 H	95	1.397
10	CH2C4F8H	65	1.376
11	CH2CH2C8F17	Tm 120	1. 354

【0019】 $1\sim4$ 及び $6\sim10$ はケトン・エステルに ライドに溶解

溶解

[0020]

5 及び11はフロン113・メタキシレンヘキサフルオ

【表 8】

1', 3', 3'-トリメチル
-6-ニトロスピロ[2H-1
-ベンプピラン-2, 2'-インドリン]

1′, 3′, 3′-トリメチル
-6-ヒドロキシスピロ〔2 H
-1-ベンゾピラン-2, 2′
インドリン〕

1', 3', 3'-トリメチル -6-プロモスピロ[2H-1 -ベンゾピラン-2, 2'-インドリン]

1'. 3', 3'-トリメチル
-8-メトキシスピロ〔2 H1-ベンゾピラン-2, 2'インドリン〕

[0021]

[表9]

: ‡

1′, 3′, 3′-トリメチル スピロ [インドリンー 2, 3′ - [3 E] -ナフト [2, 1 b] -1, 4-オキサジン]

 $1' - \triangle + シル - 3'$, 3' - ジメチル - 6 - ニトロスピロ [2 H - 1 - ベンゾピラン - 2, 2' - インドリン]

1′-ドデシル-3′, 3′-ジメチル-6-ニトロスピロ [2H-1-ベンゾピラン-2, 2′-インドリン]

1 ' - オクタデシル-3', 3' - ジメチル-6-ニトロスピロ (2 H-1-ベンゾピラン-2, 2'-インドリン)

【表:0】

[0022]

表 1 0

 $E-\alpha-(2, 5-i)$ - フリルエチリデン) - (アダマ ンチリデン)-サクシン酸無水物

2, 3-ビス(2, 4, 5-トリ メチルー3ーチエニル)マレイン 酸無水物

【0023】 実施例2

実施例1で調整した溶液を、図2に示すファイルカプラ の結合部、及び図3に示す石英至導波路のカプラ部のコ ア周辺部に、それそれキャスト法、及びスピンコート法 でフォトリフラクティブ部を形成させた。

【0024】図とは実施例2、実施例4で使用した光フ ァイバカプラを説明する図であって、21、22は光フ マイバ、23は本発明によるフォトリフラクティブ組成 物を塗布した部分を示している。また、図3は実施例 2、実施例4で使用した光導波路を説明する図であっ て、31はクラット部、32、33はコア部、34は本 発明によるフォトリフラクティブ組成物を塗布した部分 を示している。

【0025】作製したフォトリフラクディブ組成物を持 コファイルカプラ、導波路のカプラに1、3ヵm、尺は 1. 55μmの光を通しておき、実施例1と同様な光源 から元甲射したところ、屈折率が変化し、1、3 μm、 又は1 55 g 血の光をスイッチングできることが分か

【りり26】 実施例3

図1に示す構造を持つ樹脂を重合するために、MMA1 り重量部、表でに示したフィ素含有物脂のモイマーを3 り重量部、フォトリフラクティブ材料として下記式(化 40 - 又は《他し》に示す構造を持つフォトクロミック材 料を1月重量部を重合管を入れ、更に開始剤としてAI BNを全モイマーに対しても、その1モル比 連鎖移動 剤としてメルカプタンを5ミリモルブリートルとなるよ うに調整した反応溶液を重合管に入れて、脱気後、真空 封入して65%できょ時間重合させた。得られた固体を アセトンに溶解させ、水・イフノーション。1の貧溶媒 中に注ぎ1昼夜放置して再応毀させ固体を得た。この国 体をMIBK:モニクロロベンゼン:1 1 溶鉄に溶解

2.2

線を照射して照射する前後の屈折率変化を測定したとこ ろ、屈折率変化を観測することができた。

[0027]

[化1]

[0028]

[化2]

30

【0029】実施例4

実施例3で得られた共重合物のMIBK:モノクロロベ ンゼン=1:1混合溶液を図2、図3のファイバカプ ラ、導波路力プラ上に実施例2と同様の方法で試料を作 製し、実施例3と同様な検討を行ったところスイッチン が現象を確認することができた。

[6 (3 0)

【発明の効果】以上説明したように本発明を用いれば、 石英系の光ファイバや光導波路の絶対屈折率と近い値を 持つフォトリアラクティブ組成物を得ることができ、従 来のフォトリフラクティブ組成物のように石英系の光ブ アイバや光導波路との接合部での損失を少なくすること が可能となる。また、フォトリフラクティブ有機材料と フッ素含有樹脂とが共薫合体であるものでは、フォトリ させシリコン基板上にスピンコート法で薄膜化し、紫外 50 フラクティブ有機材料の構成比率を自由に設定すること

を説明する区である。

【図2】本発明の実施例2、実施例はで使用した光ファインカプラを説明する図である。

【図3】本発明の実施例8、実施例4で使用した光導皮 路を説明する図である。

【符号の説明】

21 及び22 : 光ファイバ、23 及び34 : 本発明によるフォトリフラクティブ組成物を塗布した部分、31 : クラッド部、32 及び33 : コア部

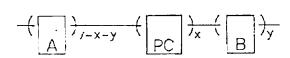
2.3

ができ、絶対国折率を自由に設定することができるようになる。フォトリフラクティブ有機材料としてフォトカロミック化合物を用いれば電場を印加することなく元の照射だけで国折率が変化し、自己保持型であるためエネルギーを消費することがなくなる。またフォトカロミズム現象に伴う団折率の変化幅も大きく、無機のフォトリフラクティブ材料と比較すると数百倍に達するなど優れた効果がある。

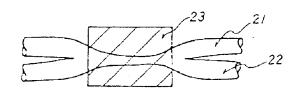
【区面の簡単な説明】

【図1】本発明のフォトリフラクティブ共重合体の組成。10

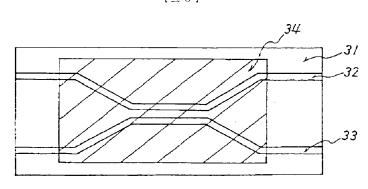
(区1)



[图 2]



[図3]



.